# OXIDATIVE REMOVAL OF ETHYLENE IN A MULTISTAGE PLASMA REACTOR IN THE PRESENCE OF TiO<sub>2</sub>



Ms. Kanokwan Saktrakool

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master of Science

The Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University
in Academic Partnership with

The University of Michigan, The University of Oklahoma,
and Case Western Reserve University

2003

ISBN 974-17-2282-6

Thesis Title:

Oxidative Removal of Ethylene in a Multistage Plasma Reactor

in the Presence of TiO<sub>2</sub>

By:

Ms. Kanokwan Saktrakool

Program:

Petrochemical Technology

**Thesis Advisors:** 

Assoc. Prof. Sumaeth Chavadej

Asst. Prof. Pramoch Rangsunvigit

Prof. Lance L. Lobban

Accepted by the Petroleum and Petrochemical College, Chulalongkorn University, in partial fulfilment of the requirements for the Degree of Master of Science.

K. Bunyaliat. College Director

(Assoc. Prof. Kunchana Bunyakiat)

Thesis Committee:

(Assoc. Prof. Sumaeth Chavadej)

(Asst. Prof. Pramoch Rangsunvigit)

Pramoels R.

(Prof. Lance L. Lobban)

(Prof. Somchai Osuwan)

(Assoc. Prof. Thirasak Rirksomboon)

#### **ABSTRACT**

4471010063 : PETROCHEMICAL TECHNOLOGY PROGRAM

Kanokwan Saktrakool: Oxidative Removal of Ethylene in a

Multistage Plasma Reactor in the Presence of TiO<sub>2</sub>

Thesis advisors: Assoc. Prof. Sumaeth Chavadei, Asst. Prof.

Pramoch Rungsanvigit, and Prof. Lance L. Lobban 58 pp.

ISBN 974-17-2282-6

KEY WORDS: Non-thermal plasma, Photocatalysis, Ehylene, Multistage

plasma reactor, TiO<sub>2</sub>

A number of techniques for air pollutant removals are available such as adsorption, biofiltration and incineration. However, these techniques require further treatment and/or are energy-intensive leading to high treatment costs. Both plasma and photocatalysis are promising alternatives since these two techniques can be operated at ambient conditions resulting in low energy consumption as compared to the conventional methods. The main objective of this work was to develop a combined plasma and photocatalytic system for VOC removals. A four-stage plasma and photocatalytic reactor system was setup to study the oxidation of ethylene as a model pollutant. An increase in either applied voltage or stage number of plasma reactors enhanced C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> conversion and CO<sub>2</sub> selectivity which is in contrast with the effects of frequency and feed flow rate. The commercial TiO<sub>2</sub> (Degussa P25), sol-gel TiO<sub>2</sub>, and 1%Pt/sol-gel TiO<sub>2</sub> were used as photocatalysts. The presence of all studied photocatalysts increased the C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> and O<sub>2</sub> conversions as well as CO<sub>2</sub> selectivity in the following order: 1%Pt/TiO<sub>2</sub> >TiO<sub>2</sub> >Degussa P25. The synergistic effect of photocatalysts presented in the plasma reactor is resulted from the activation of TiO<sub>2</sub> by the energy generated from the plasma.

## บทคัดย่อ

กนกวรรณ ศักดิ์ตระกูล: การออกซิไดซ์เอทิลีนในเครื่องปฏิกรณ์พลาสมาแบบหลายขั้น ตอนเมื่อมีไททาเนียมไดออกไซด์ (Oxidative Removal of Ethylene by a Multistage Plasma Reactor in the Presence of  ${\rm TiO}_3$ ) อ.ที่ปรึกษา รศ.คร. สุเมธ ชวเคช, ผศ. คร. ปราโมช รังสรรค์วิจิตร และ ศ. แลนซ์ แอล ลอบแบน (Prof. Lance L. Lobban) 58 หน้า, ISBN 974-17-2282-6

มีเทคนิคอยู่หลายแบบที่ใช้ในการกำจัดบำบัคมลสารอากาศ ได้แก่ การดูดซับ การกรอง ทางชีวภาพและการเผาที่อุณหภูมิสูง อย่างไรก็ตามวิธีการเหล่านี้ จำเป็นที่จะต้องมีการบำบัดขั้นต่อ ไปและ/หรือต้องใช้พลังงานสูง ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายในการบำบัคสูง การใช้พลาสมาและโฟโตคะตา ไลติกเป็นทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากทั้งสองเทคนิคสามารถคำเนินการที่สภาวะบรรยากาศ ซึ่งส่งผล ให้ความต้องการพลังงานลดต่ำลง เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีดั้งเดิมต่างๆ วัตถุประสงค์หลักในงานวิจัย นี้ คือการพัฒนาระบบพลาสมาและโฟโตคะตาไลติกร่วมกันในการกำจัดมลสารระเหยง่าย เครื่อง ปฏิกรณ์พลาสมาแบบ 4 ขั้นตอนถูกสร้างขึ้นเพื่อทำการศึกษาการออกซิเคชั่นของก๊าซเอทิถีน ซึ่ง ลูกใช้เป็นตัวแทนมลสาร การเพิ่มค่าความต่างศักย์และจำนวนขั้นตอนของเครื่องปฏิกรณ์พลาสมา ช่วยเพิ่มค่าการเปลี่ยนรูปของก๊าซเอทิลีน และการเลือกเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งแตกต่าง กับผลกระทบที่เกิดจากการเพิ่มค่าความถี่และอัตราการไหลของสารตั้งต้น ไททาเนียมไดออกไซด์ ทางการค้า (Degussa P25) ไททาเนียมไดออกไซด์โซล-เจล และ 1 เปอร์เซ็นต์แพลทินัมบนไททา เนียมไดออกไซด์โซล-เจล ถูกใช้เป็นโฟโตคะตาไลซิสท์ การใช้โฟโตคะตาไลซิสท์ทั้งหมดที่ศึกษา เพิ่มค่าการเปลี่ยนรูปของก๊าซเอทิลีนและก๊าซออกซิเจน พร้อมทั้งการเลือกเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ ตามลำคับคังนี้ 1 เปอร์เซ็นต์แพลทินัมบนไททาเนียมไคออกไซค์โซล-เจล>ไททาเนียมไคออกไซค์ โซล-เจล>ไททาเนียมไดออกไซด์ทางการค้า (Degussa P25) ผลการเสริมของการทำงานร่วมกัน ของโฟโตคะตาไลซิสท์ในเครื่องปฏิกรณ์พลาสมา เป็นผลมาจากการกระตุ้นโฟโตคะตาไลซิสท์ ด้วยพลังงาน ซึ่งกำเนิดมาจากพลาสมา

#### **ACKNOWLEDGEMENTS**

This work has been memorable, interesting and enjoyable experience. This thesis would have not been successful without the participation of the following individuals and organization.

I would like to express the deepest gratitude to my thesis advisors, Assoc. Prof. Sumaeth Chavadej, Asst. Prof. Pramoch Rangsunvigit, and Prof. Lance L Lobban, who have tendered invaluable guidance, constructive advice, and intensive attention throughout this research work. Assoc. Prof. Sumaeth Chavadej has not only taught me about theoretical knowledge but also made me realize in myself that this research is very challenging. Asst. Prof. Pramoch Rangsunvigit has taught me the skill to do the research and how to solve problems in PPC laboratory. Prof. Lance L Lobban provided valuable suggestion throughout this research work.

I also would like to thank Ms. Korada Supat, Ms. Boonyarat Harndumrongsak, and Mr. Siriphong Roatluechai for giving encouragement and invaluable suggestions.

I would like to thank CPO Poon Arjpru, who helped me to set up experimental instrument and for all electronic piecework. For PPC staff, Chaturong Tiamsiri gave me a helpful hand constantly especially about mechanical pieceworks.

This thesis work is partially funded by Postgraduate Education and Research Programs in Petroleum and Petrochemical Technology (PPC Consortium).

I also acknowledged Ratchadapiseksompoch Fund provided by Chulalongkorn University for partial support of this project and National Petrochemical (Public) Co. Ltd. for donating ethylene.

Finally, I sincerely appreciate my parents, brothers, and friends for their encouragement and understanding in myself.

## TABLE OF CONTENTS

		PAGE
	Title Page	i
	Abstract (in English)	iii
	Abstract (in Thai)	iv
	Acknowledgements	v
	Table of Contents	vi
	List of Table	viii
	List of Figures	Х
CHAPTER		
I	INTRODUCTION	1
п	BACKGROUND AND LITERATURE SURVEY	3
	2.1 Basic Principle of Plasma	3
	2.2 Generation of Plasma	3
	2.3 Basic Principle of Photocatalysis	5
	2.4 Types of Semiconductors	7
	2.5 Related Research Works	8
	2.5.1 Plasma	8
	2.5.2 Photocatalysis	11
III	EXPERTIMENTAL	13
	3.1 Materials	13
	3.1.1 Catalyst Preparation Materials	13
	3.1.2 Reactant Gases	13
	3.2 Catalyst Preparation	13
	3.3 Catalyst Characterization	14
	3.4 Oxidation Reaction Experiment	15
	3.5 Studied Conditions	17

CHAPTER		PAGE
IV	RESULTS AND DISCUSSION	18
	4.1 Catalyst Characterization	18
	4.2 Effects of Frequency	18
	4.3 Effects of Applied Voltage	24
	4.4 Effects of Feed Flow Rate	30
	4.5 Effect of a Stage Number of Plasma Reactors	32
	4.6 Effect of the Presence of Different Photocatalysts	36
V	CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS	40
	REFERENCES	41
	APPENDICES	45
	Appendix A	45
	Appendix B	47
	CURRICULUM VITAE	56

## LIST OF TABLES

TABLE		PAGE
2.1	Collision mechanisms in the plasma	4
2.2	Band positions of some common semiconductor photocatalysts	8
3.1	Experimental conditions	17
4.1	Effect of frequency on by-product selectivities at feed flow rate	1,
	160 ml/min, 11,000 V, and a gap distance of 1 cm with	
	different stage number of reactors.	25
4.2	Effect of applied voltage on by-product selectivities at feed flow	
	rate 160 ml/min, 200 Hz, and a gap distance of 1 cm with different	
	stage number of reactors.	29
4.3	Effect of feed flow rate on by-product selectivities at 11,000 V,	
,,,,	200 Hz, and a gap distance of 1 cm with different stage number of	
	reactors.	33
4.4	Effect of Photocatalyst coated on glass ring at flow rate 160 ml/min,	
	200 Hz, 9,000 V, gap distance 1 cm, and weight of photocatalyst	
	0.008 g	37
4.5	Effect of Photocatalyst coated on glass wool at flow rate 160 ml/min,	,
	200 Hz, 9,000 V, a gap distance of 1 cm, and weight of photocatalyst	
	0.008 g	38
B.1	Effect of total feed flow rate at 11,000, 200 Hz, Gap of 10 mm, and	
	$O_2$ : $C_2H_4$ ratio of 5:1	47
B.2	Effect of frequency at 11,000, feed flow rate 160 ml/min, a gap	
	distance of 10 mm, and O <sub>2</sub> : C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> ratio of 5:1	48
B.3	Effect of frequency on current and power consumption at 11,000,	
	feed flow rate 160 ml/min, a gap distance of 10 mm, and O <sub>2</sub> : C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>	
	ratio of 5:1	49
B.4	Effect of voltage at feed flow rate 160 ml/min, 200 Hz, a gap distance	e
	of 10 mm, and On: CaH, ratio of 5:1	50

TABLE		PAGE
B.5	Effect of voltage on current at feed flow rate 160 ml/min, 200 Hz,	
	a gap distance of 10 mm, and O <sub>2</sub> : C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> ratio of 5:1	51
B.6	Effect of stage number of reactor with different residence time at	
	11,000, 200 Hz, a gap distance of 10 mm, and O2: C2H4 ratio of 5:1	52
B.7	The UV light intensity measure by UV meter at feed flow rate 160	
	ml/min, 200 Hz, 9,000 V, a gap distance of 10 mm, and O <sub>2</sub> : C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>	
	ratio of 5:1	53
B.8	Comparative results of different selectivity calculation	55

## LIST OF FIGURES

F	FIGURE		PAGE
	2.1	The mechanism of photocatalytic process of a semiconductor.	6
	3.1	Schematic diagram of the experimental setup.	15
	3.2	Schematic diagram of power supply.	15
	3.3	Schematic diagram of each reactor.	17
	4.1	XRD patterns of (a) Degussa P25, (b) TiO <sub>2</sub> , (c) 1%Pt/TiO <sub>2</sub> .	19
	4.2	SEM micrographs of (a) Degussa P25, (b) TiO <sub>2</sub> , (c) 1%Pt/TiO <sub>2</sub>	
		coated on glass wool sheet.	20
	4.3	Effect of frequency on the C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> conversion at a feed flow rate of	
		160 ml/min, 11,000 V, and a gap distance of 1 cm.	20
	4.4	Effect of frequency on the O <sub>2</sub> conversion at a feed flow rate of 160	
		ml/min, 11,000 V, and a gap distance of 1 cm.	21
	4.5	Effect of frequency on current at a feed flow rate of 160 ml/min.	
		11,000 V, and a gap distance of 1 cm.	21
	4.6	Effect of frequency on CO selectivity at a feed flow rate of 160	
		ml/min, 11,000 V, and a gap distance of 1 cm.	22
	4.7	Effect of frequency on CO <sub>2</sub> selectivity at a feed flow rate of 160	
		ml/min, 11,000 V, and a gap distance of 1 cm.	23
	4.8	Effect of frequency on power consumption of $C_2H_4$ at a feed flow rate	:
		of 160 ml/min, 11,000 V, and a gap distance of 1 cm.	24
	4.9	Effect of applied voltage on C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> conversion at a feed flow rate of	
		160 ml/min, 200 Hz, and a gap distance of 1 cm.	26
	4.10	Effect of applied voltage on O2 conversion at a feed flow rate of	
		160 ml/min, 200 Hz, and a gap distance of 1 cm.	27
	4.11	Effect of applied voltage on current at a feed flow rate of 160 ml/min.	3
		200 Hz, and a gap distance of 1 cm.	27
	4.12	Effect of applied voltage on CO selectivity at a feed flow rate of	
		160 ml/min 200 Hz and a gan distance of 1 cm	28

FIGUR	FIGURE	
4.13	Effect of applied voltage on CO <sub>2</sub> selectivity at a feed flow rate of	
	160 ml/min, frequency 200 Hz, and a gap distance of 1 cm.	28
4.14	Effect of feed flow rate on the C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> conversion at 200 Hz, 11,000 V,	,
	and a gap distance of 1 cm.	30
4.15	Effect of feed flow rate on O <sub>2</sub> conversion at 200 Hz, 11,000 V, and	
	a gap distance of 1 cm.	31
4.16	Effect of feed flow rate on CO selectivity at 200 Hz, 11,000 V, and	
	a gap distance of 1 cm.	31
4.17	Effect of feed flow rate on $\mathrm{CO}_2$ selectivity at 200 Hz, 11,000 V, and	
	a gap distance of 1 cm.	32
4.18	Effect of stage number on C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> conversion with different residence	
	time at 200 Hz, 11,000 V, and a gap distance of 1 cm.	34
4.19	Effect of stage number on O <sub>2</sub> conversion with different residence	
	time at 200 Hz, 11,000 V, and a gap distance of 1 cm.	34
4.20	Effect of stage number on CO selectivity with different residence	
	time at 200 Hz, 11,000 V, and a gap distance of 1 cm.	35
4.21	Effect of stage number on CO <sub>2</sub> selectivity with different residence	
	time at 200 Hz, 11,000 V, and a gap distance of 1 cm.	35
4.22	The UV light intensity measure by UV meter at feed flow rate 160	
	ml/min, 200 Hz, 9,000 V, and a gap distance of 1 cm.	39